不锈钢钝化膜形成和破坏过程的原位 ECSTM 研究 *

胡艳玲11 胡融刚21 邵敏华21 林昌健121

1) 厦门大学材料科学与工程系, 厦门 361005

2) 厦门大学化学系固体表面物理化学国家重点实验室。厦门 361005

摘 要 利用电化学扫描隧道显微镜 (ECSTM),原位研究不同电位下不锈钢在 0.5M H₂SO₄ + 0.02M NaCl 溶液中表 面形貌的动态行为,并对论电位对不锈钢电化学阻抗谱 (ElS) 的反响 结果太明 不锈钢在活化 钝化过渡区电位表面粗糙度最 大:进入钝化区后、在钝化膜完繁处,电位越高,表面粗糙度起小,钝化膜呈有序生长 在钙化膜薄弱处,电位控制在 0.2 V 时, 钝化膜最为完整 40.5 V 时,表面像点蚀汽开始萌生 电位为 0.8 V 时,已有的做点蚀坑有所生₁、 不锈钢表面 ECSTM 形, 短与电化学阻抗潜测量呈对应关系:电位为 0.2 V 时,表面钝化膜最为完整 阻抗最大,电位为 0.5 V 时,在钙化膜薄弱处萌生 点蚀坑,钝化膜阻抗有所下降;电位为 0.8 V 时,钝化膜完整处得到时髦的整平 阻抗相比 0.5 V 时,昭显提高,但由于已萌生的 微点蚀坑开始生长,阻抗相比 0.2 V 时仍有所降低

关键词 不锈钢、扫描隧道显微技术、电化学阻抗谱、钝化、点腐蚀 **中图法分类号 TG1**15.21, TG142.71 **文献标识码** A **文章编号** 0412-1961(2001)69-0965-06

IN SITU ECSTM INVESTIGATION ON FORMATION AND BREAKDOWN OF PASSIVE FILM FOR POLYCRYSTALLINE STAINLESS STEEL

 $HU \ Yanling^{(1)}, \ HU \ Ronggang^{(2)}, \ SHAO \ Mrnhua^{(2)}, \ LIN \ Changgian^{(1/2)}$

1) Department of Material Science and Engineering, Xiamen University, Xiamen 361005

2) State Key Laboratory for Physical Chemistry of the Solid Surfaces and Department of Chemistry, Xiamen University, Xiamen 361005

Correspondent: LIN Changjian, professor. Tel: (0592)2189354, Fax: (0592)2189354, E-mail: cjlim@xmu.edu.cn

Manuscript received 2001-01-12, in revised form 2001-04-19

ABSTRACT The dynamic behavior of surface topography for the stainless steel in 0.5M H₂SO₄+ 0.02*M* NaCl was traced *in situ* by electrochemical scanning tunneling microscope (ECSTM). The results showed a different response for the integrated passivated domain and pit-prone location on the surface when a given potentials was applied to the sample. The roughness parameter Sa for both domains appeared a maximum when controlled potential in the transition passivation region. In the potential region of passivation, passivated grains began to grow orderly on the integrated domain, and Sa decreased with increasing potential. While on the pit-prone domain, metastable micro-pits were observed when a passive potential was controlled at 0.5 V and 0.8 V. The impedance behaviors for steel sample in the different potential regions of passivation were examined by electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and discussed based on the ECSTM results. At 0.2 V potential, the flawless surface showed the greatest impedance, and at 0.5 V, the impedance droped due to the initiation of metastable micro-pit. When controlled potential at 0.8 V, the surface roughness decreased considerably on the integrated domain, but the total impedance showed smaller resulted from the development of micro-pit in the preference location.

KEY WORDS stainless steel, scanning tunneling microscopy, electrochemical impedance spectroscopy, passivation, pitting corrosion

工业不锈钢表面钝化膜总是存在着成分、结构及形态 的不均一性。在含 CIT 的环境介质中、点蚀往往优先发生 在晶界、析出相、位错及腐蚀活性夹杂物等缺陷处。由此、 不锈钢表面不同位置对电位的响应也必然是不均一的。不 锈钢表面钝化膜的尺度为纳米级、常规的显微镜、电镜或 一般的非原位方法难以在原位研究钝化膜表面形貌随环 境的变化过程。传统的动电位扫描、电化学频谱阻抗测量 (EIS)等也只能获得不锈钢表面整体平均的信息。研究者 往往通过测量特征电位、电流及阻抗值的变化等来推测金 属表面的反应机制、评估不锈钢钝化性能和耐腐蚀特性

日前、能够从微观的空间分辨度研究不锈钢钝化膜方 法主要有扫描微电极技术和电化学扫描隧道显微镜技术 (ECSTM)等. 扫描微电极技术能够原位获得不锈钢表面 微米尺度上的电位、电流等空间分布及变化、在不锈钢钝 化膜破坏和局部腐蚀的研究方面已取得许多有价值的信 息^{1]}. ECSTM 则能够实现纳米级微观形貌的原位动态 研究^[2-4]. 目前、虽然有若干将 ECSTM 用于 304 不锈 钢^[5]、纯 Fe^[6]、单晶 Cr^[7]的表面钝化模的原位研究、 但仍局限于单晶或具有高度取向结构的表面、付多晶不锈 钢钝化膜的形成及破坏的 ECSTM 研究报道较少

多晶不锈钢在不同电位下其表面钝化膜的消长和腐 蚀破坏呈复杂的动态变化过程,特别是在特征电位条件 下可发生明显突变.本文利用扫描隧道显微镜和自制的 恒电位仪组成 ECSTM,对处于 0.5*M* H₂SO₄+ 0.02*M* NaCl 溶液中的 Cr11Ni13 不锈钢多晶试样进 行原位研究.通过在不同位置的重复实验,找出典型微观 区域,分别记录其随电位改变的表面形貌变化.结合电化 学阻抗谱 (EIS),试图进一步直接观测不锈钢表面钝化膜 消长、腐蚀破坏动态过程,探明表面不均一性对诱导局部 腐蚀破坏的作用 ^[1,8],并从微观角度对下锈钢阳极过程的 宏观腐蚀电化学行为进行讨论.

1 实验方法

图 1 为 ECSTM 测量系统原理示意图 其中、SPM 为俄罗斯产、型号为 P4-SPM-MDT 的扫描探针显微镜: 恒电位仪为自制微型无源单恒电位仪.



图 1 ECSTM 测量原理示意图 Fig.1 Schematic diagram of ECSTM equipment setup

电极池 为三电极体系. 其中参比电极为 Ag/AgCl 电极、辅助电报为铂丝, 研究电极为 Cr11Ni13 多晶不锈钢, SPM 针尖材料为钨丝, 在 3M KOH 溶液中用电

化学刻蚀法制得针尖,然后用熔融聚甲基苯乙烯包封。使 得法拉第电流降至隧道电流的 5% 以下,可有波消除流过 针尖的法拉第电流的影响

研究 电极用环氧树脂包封 待測 表面面积约为 0.12 cm². 依次用 500 号水砂纸、 04 号金相砂纸、 06 号金相砂纸打磨、 0.75 μ m Al₂O₃ 粉末、 0.5 μ m Al₃O₃ 粉末研磨至镜面.最后用超纯水 (电阻 18 MΩ) 付 研究电极进行超声波清洗. 将多比电极和辅助电极固定在 特制的电解池上、然后用 703 硅橡胶将电解池结在研究电 极上. 侍硅橡胶固化后、装在 SPM 试样平台、注入 0.5M H₂SO₄ + 0.02M NaCl 溶液、进行 ECSTM 测量. 研究 电极在水平方向扫描测量范围 与 800 mm · 800 mm. 系 用恒电流模式、恒电流值为 1 nA 采用 EG&G 公司生产 的 263A 型恒电位仪、 5210EC 型锁相放大器、分别测 量 Cr11Ni13 不锈钢在 0.5M H₂SO₄ + 0.02M NaCl 溶液中的钝化曲线和不同电位下的电化学阻抗谱图.

2 实验结果

2.1 不锈钢试样的成分和结构

研究电极 为高频炉冶炼的不锈钢试样。用电感耦合等 离子体原子荧光光谱法测试其化学成分 (质量分数、 %) 为: C 0.23、Cr 11.63、Ni 13.57、Fe 全量 不锈钢试样 表面的 XRD 实验结果如图 2 所示 由图 2 可见。不锈 钢试样呈多晶结构。



图 2 Cr11Ni13 不锈钢表面的 XRD 带图 Fig.2 X-ray diffraction patterns of Cr11Ni13 stainless steel

2.2 不锈钢钝化曲线的测量

采用控制电位法测量 Cr11Ni13 不锈钢存 0.5M H₂SO₄ - 0.02M NaCl 溶液中的阳极钝化曲 线,扫描速度为10 mV/min,结果示于图 3. 由图可见, Cr11Ni13 不锈钢在 0.5M H₂SO₄ + 0.02M NaCl 溶 液中阳极过程存在明显的活性溶解区、钝化区、活化 -钝化过渡区。其中:致钝电位为 -0.147 V,维钝电位为 0.2 V,过钝化电位约为 0.9 V.根据阳极极化曲线选定位 于活性溶解区、活化 - 钝化过渡区、钝化区的若干特征电 位、采用 EIS 和 ECSTM,测量在这些电位下不锈钢的



图 3 Cr11Ni13 小锈钢在 0.5*M* H₂SO₄→0 02*M* NaCi 容液 中的动电位扫描极化曲线

Fig.3 The potentiodynamic curve of Cr11Ni13 SS in $0.5M~{
m H_2O_4}{+}0.02M~{
m NaCl}$ solution

EIS **谱图及表面 STM 图象、研究在不同电位下不锈钢** 阻抗和表面微观形貌的变化过程及相互关系. 控制电位依 次 为: 开路电位 $E_c(-0.38 \text{ V})$ 、阴极活性溶解电位 $E_k(-0.40 \text{ V})$ 、阳极活性溶解电位 $E_a(-0.35 \text{ V})$ 、活化 - 钝化 过渡电位 $E_t(0.0 \text{ V})$ 、钝化电位 $E_{p1}(0.2 \text{ V}), E_{p3}(0.5 \text{ V}), E_{p3}(0.5 \text{ V}).$

2.3 不锈钢电极的 EIS 谱图的测量

图 4 中不同电位时的 EIS 谱图是在每个电位稳定 15 min 后开始测量的。由图可见。除了在过渡钝化电位 *E*, 出现负阻抗特征外、在其它电位下的阻抗基本呈 RC 半圆、主要表征为不锈钢表面钝化膜的阻抗。当控制电位 *E*_a(-0.35 V) 略正于开路电位。由于阳极极化使不锈钢钝 化膜阻抗降低。而在阴极极化 *E*_k, 阻抗显然增大, 说明微 弱的阴极极化不会造成不锈钢钝化膜的还原破坏, 而且有



图 4 Cr11Ni13 下锈钢在 0 5M H₂SO₄-0.02M NaCl 溶液
 中不同电位下的 EIS 谱图

Fig.4 Nyquist dagrams of Cr11Ni13 SS in 0.5M H₂SO₄+ 0.02M NaCl recorded after being polarized for 15 min at $E_c = E_k, E_a, E_t, E_{p1}, E_{p2}$ and E_{p3}

利于不锈钢的钝性的维持

当电位位于UV的活化-纯化电位过渡区、EIS 谙 图的低频区出现负阻抗,此时对应于不锈钢表面钝化模形 成的动态过程,随极化时间的延长, 谱图的低频区的负阻 抗变大

当电位控制在 0.2、0.5、0.8 V, 虽然处于纯化乙的下 同电位值, 但表面阻抗有较大差别: 在 0.2 V 时的阻抗最 大、急阻抗值达 75.89 k Ω ; 在 0.8 V 的阻抗值次之、为 61.86 k Ω : 而存 0.5 V 时, 阻抗值最小、为 45.64 k Ω 在不同的电位,不锈钢表面反应和钝化模结构不同, 其狙 抗行为也有差异

2.4 不锈钢表面微区原位 ECSTM 形貌测量

大量重复实验表明,不锈钢表面典型的微观形貌特征 可分为两种 完整钝化膜部分和薄弱易于腐蚀破坏的钝化 膜区域,下面分这两种情况讨论不锈钢表面微观形貌。

2.4.1 转化膜完整处的 ECSTM 形色 图 5 是不 铸钢表面钝化膜比较完整区 (800 nm · 800 nm) 的微观 形貌随电极电位和极化时间的变化特征.不铸钢试样在开 路电位稳定后,其表面 ECSTM 图象随时间下再变化.此 时形貌特征为. 表面钝化膜呈均匀的椭球形结构分布、样 球形结构的尺度约为长 200—250 nm. 宽 100—150 nm, 高 5—10 nm. 如图 5a 所示. 在阴极极化和阳极极化的 条件下、钝化膜表面形貌随之发生变化. 在阴极极化时, 发生析氢反应, 在钝化膜比较薄弱的位置优先部分还原消 失. 而在钝化膜较厚的位置形貌基本不变. 当再施加阳极 极化时、残余的钝化膜发生均匀溶解、钝化膜椭球形结构 变化、见图 5b.

当控制电位为 0 V 不锈钢钝化膜微观形短即刻受生 明显变化。如图 5c 所示 钝化膜表面重新生成半球形氧 化物或氢氧化物突起。表明不锈钢有很强的钝化能力,控 制电位下形成的表面氧化物或氢氧化物的结构尺寸比自 然形成的钝化膜椭球形结构大、约为 300 nm < 250 nm + 10 nm. 0.2 V. 0.5 V. 0.8 V 为稳定钝化区的三个电位 值。从图 3d, e, f 可见 在这三个电位下、不锈钢表面钝化 膜椭球形突起结构形貌仍随电位而变化:随电位正移、钝 化膜氧化物或氢氧化物不断成长、从半球形结构变成月牙 形突起形貌。并件有新的氧化物或氢氧化物成核、生长。 实验证明,在钝化区完整的钝化模生长过程的动态重整。 钝化膜突起结构随电位的升高呈定向有序生长。

2.4.2 纯化膜薄弱处的 ECSTM 形象 图 6 为钝 化膜比较薄弱区域 (800 nm×800 nm)的 ECSTM 原位 微观形貌随电极电位和极化时间的变化特征。当下锈钢受 到阳极极化 (E_a)时、钝化膜呈下均匀溶解破坏、图 6a 表 明、在表面的左上方出现微腐蚀点。将下锈钢的极化电位 阶跃到 0 V,不锈钢钝化膜表面微观形貌发生明显改变、 表面生成许多均匀细小的金属氧化物或氢氧化物突起结



图 5 CritiNil3 不锈钢表面纯化模完整处的 ECSTM 形貌随电位支化图

Fig.5 In situ ECSTM images for integrated domain of Cr11N(13 SS surface in 0.5M H₂SO₄+0.02M NaCl solution x=y=800 nm. z=20-66 nm

(a) E_c , after immerging in solution for 40 min (b) $E_{11}, t_3 = 10$ min

(c) $E_{t}, t_{t}=5 \text{ min}$ (d) $E_{p1}, t_{p1}=14 \text{ min}$ (e) $E_{p2}, t_{p2}=15 \text{ min}$ (f) $E_{p3}, t_{p3}=20 \text{ min}$



图 6 CritNit3 不锈钢表面纯化膜薄弱处的 ECSTM 形貌随电位变化图

Fig.6 In situ ECSTM images for pit-prone domain of Cr11Nit3 SS surface in 0.5M H₂SO₄=0.02M NaCl solution, x=y=800 nm, z=60=80 nm

(a) $E_{a}, t_{a}=20 \min$	(b) $E_{t_1} t_t = 23 \min$
(d) $E_{p2}, t_{p2}=4 \min$	(e) $E_{\rm p2}, t_{\rm p2}{=}20~{ m mm}$

构,呈椭球形,底部的长约为100—150nm,宽约为50 100 nm,高约为3—10 nm,由于仪器的微小热漂移,原 来位于左上方的微点蚀坑移至左方中部(图 6h). 并发现 在此条件下,由于钝化膜的生长使微点蚀坑在一定程度上 得到修复,说明在过渡电位 *E*_c,不锈钢表面微点蚀坑或薄 (c) $E_{p1}, t_{p1} = 10 \min$ (f) $E_{p3}, t_{p3} = 19 \min$

弱位置能够生成新的氧化物颗粒 钝化膜得以修补.

当电位控制在 0.2 V 时,不锈钢完全进入钝化状态, 在此电位下、原有的钝化膜突起结构随时间逐渐台并、沟 槽得到整平、见图 6c,从 ECSTM 图的高度差可见,在 0.2 V 极化 20 min 后,高度差由原来的 80 nm 减小到 63 nm. 当电位升高到 0.5 V 时、由图 6d, e 可视察到 右方的钝化膜发生局部溶解破坏,产生微点蚀坑,微点蚀 坑周围的钝化膜随时间缓慢溶解,但点蚀坑的深度变化不 大,且随时间延长而有起伏,表明此时微点蚀处于萌生阶 段,并下稳定

图 6f 表明,当电位增加到 0.8 V 时、微点蚀坑的深度有所增加。微点蚀进一步发展。但随时间延长、微点蚀坑的深度并下持续增长,证明微点蚀的生成是只是宏观点蚀的必要条件,而下是充分条件^[9].

2.4.3 假区表面粗糙度随电位变化的定量分析

根据图 5,6 钝化膜完整位置及钝化膜薄弱位置随电 位变化的 ECSTM 形貌。可分别对微区表面粗糙度随电 位的变化进行定量分析、结果示于图 7. 微区表面粗糙度 以测量区间的 Sy, Sa 来表示、其定义如下

$$S_{\mathbf{y}} = Z_{\max} - Z_{\min}$$
$$S_{\mathbf{a}} = \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} |Z(i,j)|$$

其中、 Z_{max}、Z_{min} 分别表示整个扫描区间最高点及最低 点的高度, N 表示总测量点数, S_y, S_a 由图形分析软件 P7-spm 测量分析完成 图 7 中, 每个电位下的表面粗糙 度均取自该电位下的最后一幅 STM 图象, 由图可见, 在 钝化膜完整处, 框糙度 S_a 随电位极化顺序不断增大, 在 过渡电位 0.0 V 时达到最大: 当电位进入钝化区时, S_a 随电位增大而不断减小, 结合 ECSTM 形貌 (图 5)



图 7 Cr11Ni13 不锈钢表面软区粗糙度 SaSy 随电位的变化曲线

Fig.7 Surface roughness parameters S_a (integrated domain), S_y (pit-prone domain) of Cr11Ni13 SS at various potentials (solution 0.5M H₂SO₄+0.02M NaCl, Scope: 800 nm + 800 nm), according to fig.5 and 6

可知,在不锈钢表面钝化膜完整处,当电极电位处于钝化 电位区时,随着电位的升高,表面钝化膜颗粒呈有序化生 长,表面发生一定的整平作用,表面粗糙度降低

在钝化膜薄弱位置,当电位处于过渡电位 0.0 V 时 表面粗糙度是最大的,当电位进入钝化区后,电位为 0.2 V 时, S,有明显的降低,然而、随着钝化电位的继续提高、 S、随电位增大而增大,说明此时有微点蚀坑的生成,根据 图 7、当不锈钢的电极电位为 0 V 时,不论是在钝化填充 整处还是在钝化膜薄弱处,表面粗糙度 S_n 都是最大的 可解释为在过渡电位,不锈钢中元素 Cr 进入钝化、而元 素 Fe 仍处于活性溶解区 ^[9]、整个表面处于不均匀溶解、 从而导致表面粗糙度的增大.

3 讨论

通过在不锈钢表面不同位置 ECSTM 扫描测量、对 多晶不锈钢表面的钝化模完整区域及钝化模薄弱区域分 别进行研究, 其中, 钝化模薄弱处的 ECSTM 形貌特征 更引人关注, 这是因为钝化模薄弱处的性能往往决定不锈 钢钝化膜耐局部溶解破坏性能. 一般用于评估不锈钢耐点 蚀性能的方法是采用动电位扫描测极化曲线的方法, 通过 点腐蚀电位 E_p 来判断不锈钢的耐局部腐蚀性能, 并认为 只有在 E_p , 点蚀才能发生, 近年来, 扫描微电极技术的研 究^[1] 已证明, 在远低于传统的 E_p 电位区间、即可能发 生"不稳定微点腐蚀", 下稳定微点腐蚀的发生是由于钝 化膜动态溶解和局部破坏引起的, 但往往不能发展为稳定 的宏观点腐蚀^[9].

实验结果证明、当电位为 0.5 和 0.8 V 时,尽管仍处 于钝化电位区间,在钝化膜薄弱处仍观察到钝化膜的溶解 破坏和微点蚀坑的形成,然而,这种点蚀坑深度只有几十 纳米,且腐蚀坑的深度随时间并不稳定增长,由此可认为 是一种"不稳定微点蚀坑"的生成,与扫描微电极研究结 果一致^(1,9)。

需要指出的是、由于"不稳定微点蚀"的出现具有随 机性,而 ECSTM 实验的扫描面积很小。 ECSTM 实验 捕捉到微点蚀的机会相应也很小。所以图 6 所示的实验 结果的重复性不高。但还是能够结合 ECSTM 的实验结 果、对处于钝化电位区不同电位下。不锈钢钝化模宏观耐 蚀特征的 EIS 阻抗进行合理的解释。

当不锈钢完全进入钝化区,即控制电极电位为 0.2 V 时, 在钝化膜薄弱处、钝化膜突起结构随时间逐渐合并 钝化膜突起结构间的沟槽随时间缓慢消失,而在钝化膜较 完整处,钝化膜颗粒开始有序生长,此时钝化膜最完整,且 无点蚀萌生,所以在 0.2 V 时不锈钢的电化学阻抗最大, 当下锈钢的电位提高到 0.5 V 时,在钝化膜比较薄弱的局 部位置开始破裂、溶解、微点蚀坑萌生。在宏观上表现为 下锈钢整体电化学阻抗有所下降。当下锈钢的电位提高到 0.8 V 时,在不锈钢表面大部分区域的钝化膜完整处,钝化 **岐有序生长、表面粗糙度明显减小(图7).使得电极有效** 面积相应减小、已有研究表明^{10,11]},随着钝化电位的升 高.钝化膜的成分由金属氢氧化物更多地向金属氧化物转 变 从而使得此时钝化膜的阻抗相比 0.5 V 时有所提高. 然而.在钝化膜薄弱处,已经萌生的点蚀不能被修复,且有

·定程度的生长、所以钝化膜的阻抗还是小于 0.2 V 时的 阻抗.由此可见,不锈钢宏观上的电化学阻抗特征是由微 观上钝化膜完整处和钝化膜薄弱处的性质所共同决定.

4 结论

建立了一种 ECSTM 电化学控制系统、付 Cr11Ni13 多品不锈钢在 0.5*M* H₂SO₄+ 0.02*M* NaCl 溶液中钝 化膜的形成、消长及腐蚀破坏过程的表面微观形貌特征进 仔研究. 该 ECSTM 系统具有设备简单、干扰少、测量 易行的优点、结果表明:多晶不锈钢宏观 EIS 电化学阻 抗特征是由微观上钝化膜完整处、钝化膜薄弱处的性质共 同决定的.进入钝化区后,在钝化膜完整处、电位越高, 钝化膜呈有序生长.表面粗糙度越小.在钝化膜薄弱处, 0.2 V 时的钝化膜最为完整, 0.5 V 时有不稳定微点蚀 坑萌生. 0.8 V 时已有的微点蚀坑有所生长.原位 EC-STM 测量是直接观测不锈钢在含 Cl⁻⁻ 介质中钝化膜的 消长 -- 重整和膜局部溶解破坏及微点蚀发生等动态过程 的有力研究工具

参考文献

- Lin C J. Tian Z W J Phys Chem, 1987; 3: 479 (林昌健, 田昭武, 物理化学学报、 1987; 3: 479)
- [2] Bai C L. The Principle and Application of Scanning Tunneting Microscopy, Press of Science and Technology in Shanghat, 1992
 [1]春礼编著, 扫描隧道显微本及其应词、上海 上海科学校子

出版社、 1992)

- [3] Marcus P. Electrochimica Acta, 1998: 43: 109
- [4] Li Y, Cao C N, Lin H C. Corrosson Sci Protection Technol, 1998; 10: 284

) 李 瑛, 曹楚南、林海南 廣蚀科学与防护技术, 1998; 10 284)

- [5] Fan F R, Bard A J, J Electrochem Soc, 1989; 136: 166
- [6] Bhardwai R C, Martin A G, etc. J Electrochem Soc, 1991; 138: 1901
- [7] Zuili D, Maurice V, Marcus P J Phys Chem 1999; 103-7896
- [8] Lin C J, Xie Z X, Tian Z W Corression Sci Protection Technol, 1997. 9: 173 (林昌健,谢礼雄 田昭武 意蚀科学与海护技术, 1997, 9 173)

[9] Lin C J, Luo J L, Zhuo X D Tian Z W Corrosion, 1998.
 54. 265

- [10] Fujimoto S, Shibata T, et al., Corrosion Sci 1993; 35: 147
- [11] Lin C J, Tian Z W J Chin Soc Corrosion Protection, 1985, 5–177

(林昌健,田昭武,中国腐蚀与防护学报,1985;5:177)